

ラッピング Lapping ポリッシング Polishing マシンの紹介

ダイヤモンドスラリー仕様

For GMR Head



NANOTECH-3800D

GMR'S ABS SIDE PROCESS MACHINE
OSCILATION LAPPING

(KISSLAP)

For GMR Head



NSL-115K

FINAL LAPPING MACHINE FOR GMR HEAD
SUPER KISS LAPPING MACHINE

ダイヤモンドスラリー仕様



NANOTECH-380-FODAL

GMR HEAD PROCESSING MACHINE

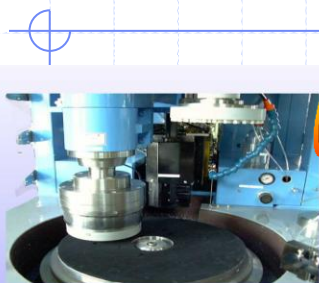


NANOTECH-380-FDAR

GMR HEAD'S CROWN PLATE MAKING MACHINE

- ・DIAMOND CHARGING
- ・Z STROKE PROCESS HEAD INSTALLED

ダイヤモンドスラリー仕様



GaN用ダイヤモンドポリッシング機

CMPダイヤモンドポリッシング機



NANO-450-FODAb



NANOTECH-450-FODCRAb

WAFER CMP MACHINE

- ・SLOPE POLISHING
- ・SWING MECHANISM
- ・DRESSER ELECTRODEPOSITION & BRUSH
- ・AIR BAG
- ・COMPULSION DRIVE

ダイヤモンドスラリー仕様

ダイヤモンド両面フック

ダイヤモンド両面フック



NANO-3LB-2M

BLUE · WHITE LED 'S DOUBLE SIDE POLISHER



NANO-4DB-3MW-11

DIAMOND DOUBLE SIDE LAPPING MACHINE
FOR GMR HEAD & PROCESS ROVER
3 MOTOR COOLING SYSTEM (FLATLESS LESS THAN 0.5um)

GC/WA スラリー仕様

水晶用両面ラップ



NANO-3LB-2M

DOUBLE SIZE LAPPING MACHINE
FOR CRYSTAL · PIEZO-ELECTRIC ELEMENT
(FLATNESS LESS THAN 1 μ m)

石英マスクポリッシング機



プレート径φ2,400mm

NANO-2400RP-4

LARGE SCALE POLISHING MACHINE
MASK, LASER REFLECTION MIRROR
OPTICAL FLAT'S POLISHING MACHINE

- PLATE OD ϕ 2400mm
- 4 STROKE PROCESS STATION
- PLATE SYNCHRONIZATION COMPLUSION DRIVE

GC/WA スラリー仕様



NANO-5LB-2M

DOUBLE SIDE LAPPING MACHINE (FLATNESS LESS THEN 1 μ m)
DESIGN TO USE FOR GLASS, PIEZO-ELECTRIC ELEMENT
& STEPPER PARTS



NANO-15LB-2M

GMR'S WAFER BASE PLATE (ALTiC) PROCESS
DOUBLE SIDE LAPPLING ($\phi 3'' \sim 6''$)
2 MOTORS DRIVE

アルミナ スラリー仕様

AUTOMATIC CMP SYSTEM



NANO-16PB-3M

2.5"・3.5" HD DOUBLE SIDE LAPPING MACHINE
GLASS·AL BASE PLATE
3 MOTORS DRIVE

NAC-460-AP

C TO C
DRY WET
IN OUT

アルミナ スラリー仕様

ポリッシング機



NANOTECH-500DOAb

CMP WAFER, CMP MACHINE (MAX $\phi 6''$)

CMPポリッシング機



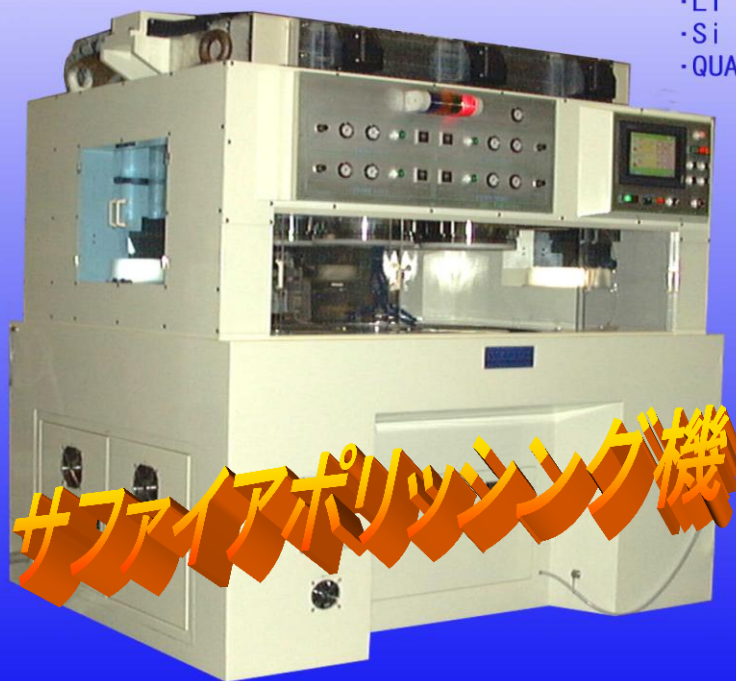
NANOTECH-600-FODCAb

GMR HEAD'S BASE PLATE PRODUCTION MACHINE
FOR $\phi 3''$ $\phi 4''$ $\phi 5''$ $\phi 6''$ (MAX $\phi 6''$)

シリカ スラリー仕様

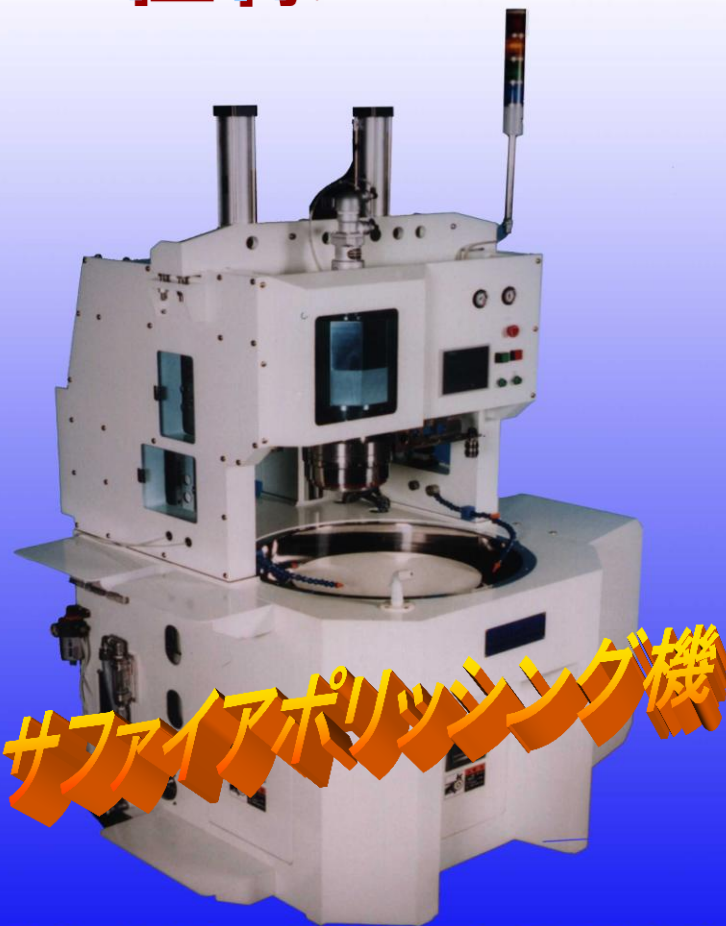
SAPPHIRE WAFER POLISHER FOR $\phi 2'' \sim \phi 12''$
SWING MECHANISM, COMPULSION DRIVE
UNIFORM PRESSURE
FACING MECHINE 0-300RPM
PLATE OD $\phi 930\text{mm}$
PRSSURE PLATE OD $\phi 305\text{mm}$

- Al₂O₃
- SiC
- SiN
- LN
- LT
- Si
- QUARTZ



サファイアポリッシング機

NSL-930-BFH-4



サファイアポリッシング機

NANO-450-DOCAb

ITO FILM POLISHER FOR ORGANIC EL DISPLAY
INSTALLED WITH AIR BAG HEAD, SWING MECHANISM
& COMPULSION DRIVE SYSTEM

シリカ スラリー仕様



GaAsポリッシング機

NANOTECH-500STZ-6
SILICON WAFER SEMI-AUTO CMP MACHINE



GaAsポリッシング機

NANO-450-ODBAb

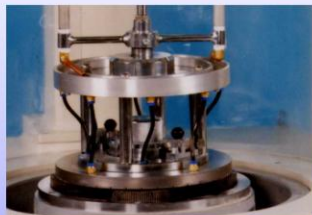


酸化セリウム スラリー仕様



水晶用両面ラップ機

POLISHING MACHINE OF SUPER THIN CHEMICAL
NANO-3CB-2M
DOUBLE SIDE POLISHING MACHINE FOR CRYSTAL PROCESS
THICKNESS ACCURACY 30um ~ 70um)
TWO MOTOR DRIVE



PITCH POLISHER FOR LARGE SCALE OPTICAL PART
FACING MECHANISM
PLATE SIZE 2000mm
COMPULSION DRIVE
3 WORKS STATION

- ・QUARTZ
- ・Zn-Se
- ・Si
- ・SiC
- ・YAG

プレート径 $\phi 2,000\text{mm}$



石英マスクポリッシング機



NSL-2000-GF3R

酸化セリウム スラリー仕様

AUTOMATIC POLISHER FOR CD, DVD GLASS

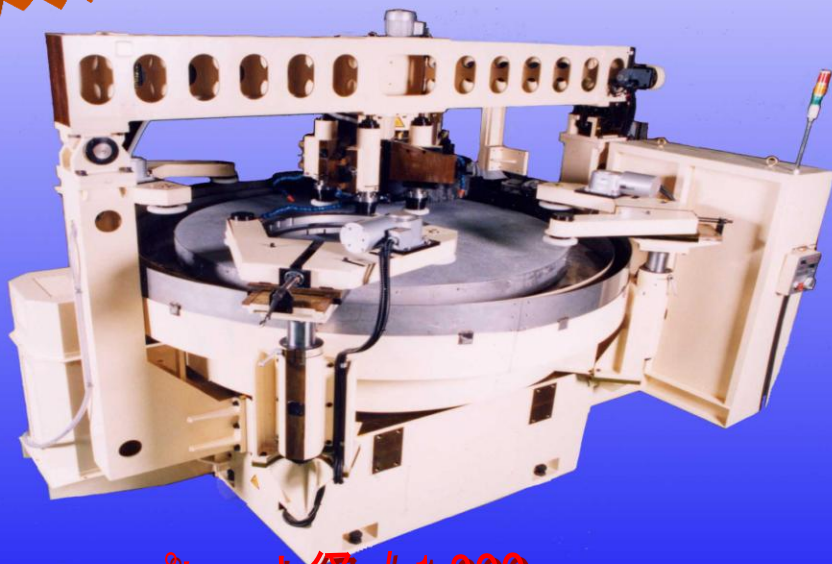
MAX ϕ 220mm

WET IN

WET OUT

INSTALLATION PLATE : Al_2O_3 · SiC · SiN · OTHER

光学フラット研磨用 ピッチポリッシャー



プレート径 ϕ 1,800mm

NANOTECH-1800LPP

OPTICAL FLAT, LASER REFLECTION POLISHING MACHINE



GaAs 全自動ポリッシング機



N-610AT

Chemical Slurry仕様

FULLY AUTOMATIC POLISHER

GaAs. InP. Si. LT. LN. FINAL POLISHER
DRY IN WET OUT
MAX $\phi 3'' - \phi 6''$



Full Auto GaAs ポリッシング機

NSP-600AT



GaAs ポリッシング機

NANOTECH-1400Dab-1/1

- $\phi 6''$ POLISHING MACHINE FOR GaAs
- $\cdot \phi 485$ AIR BAG
- \cdot CHEMICAL PROOF
- \cdot RISE & SHOWER INSTALLED
- \cdot DRESSER (BRUSH, ELECTRODEPOSITION)
- \cdot COMPULSION DRIVE

Chemical Slurry仕様

Chemical

PVC

Sapphire Polishing Machine

NKP-450-OAH

GaAs CLEAN POLISHER
CHEMICAL & CORROSION PROOF

GaAs Polishing Machine

NANO-450-ODBAb****



Chemical Slurry仕様

Chemical



NANO-610DOC-2

POLISHING MACHINE FOR GaAs
FOR $\phi 3"$, $\phi 4"$, $\phi 6"$
CHEMICAL & CORROSION PROOF

Chemical



GaAsポリッシング機

NANO-910Ga-4R

POLISHING MACHINE FOR GaAs
INSTALLED WITH
・COMPULSION DRIVE SYSTEM
・SHOWER
・RISE

冷却加温循環チラー



±0.1°C管理

NANOCS-CWI-HS-4

COOLING-CALEFACTORY WATER CIRCULATION CHILLER
COOLING FOR 4 LAPPING MACHINES (±0.5°C MANAGEMENT)

研磨剤、治具、キャリア、砥粒ポンプ



薄厚用メッシュキャリア

GMR DOUBLE SIZE CARRIER



ABS FACE FINAL PROCESS TOOL



ELG TOOL

ELG 治具

ELG TOOL & CARRIER

Polishing Slurry



POLISHING SLURRY & DIAMOND SLURRY

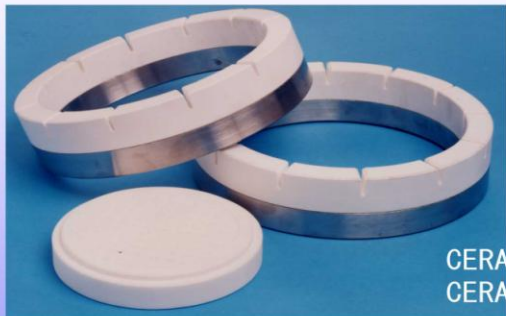
NANOPOLI Slurry



10L STIRING FUNCTION TANK

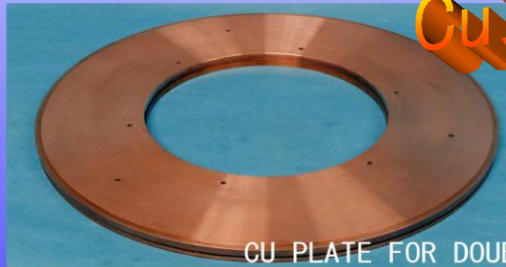
NANOPOLI SLURRY

修正リング、プレート、フラットネスゲージ



CERAMIC CORRECTION RING
CERAMIC VACUUM ZIPPER

修正リング



CU PLATE FOR DOUBLE SIDE MACHINE

Cuプレート



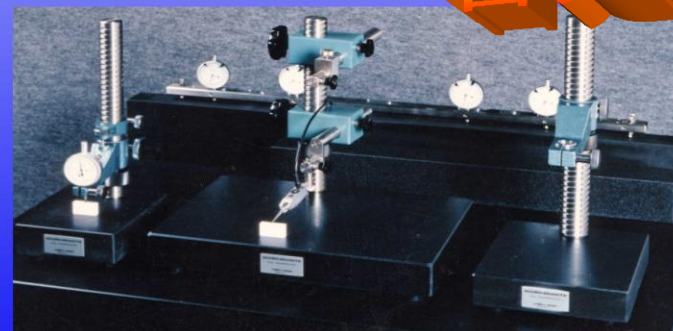
Polishing Pad

GOODS ・ PLATE

フラットネスゲージ



石定盤



STONE FIXED BOARD

FOR FLATNESS MEASUREMENT

両面ラッピング3LB-2M

SPECIFICATION

- 装置寸法・・・W700×D1100×H2200 (mm)
- プレートサイズ・・・OD φ190mm×ID φ90mm
- キャリア軽・・・・PCD 50mm
- 最大加工物径・・・φ45mm
- キャリア仕入れ数・・・5枚
- 下定盤回転数・・・0～60rpm
- 下定盤モータ・・・ギヤードモータ 0.75kw
インバーター制御
- 減圧機構・・・3段階リニア減圧機構
- インターナルギヤモータ・・・ギヤードモータ 0.4k
w インバーター制御
- 制御方式・・・シーケンサ制御
- 操作パネル・・・液晶タッチパネル
- その他・・・サンギヤ昇降機構
上定盤シリンダー昇降機構



NANO-3LB-2M

BLUE · WHITE LED 'S DOUBLE SIDE POLISHER

450-FODAb

SPECIFICATION

装置寸法・・・W1000×D1950×H2290 (mm)

プレートサイズ・・・φ450mm SUS製

プレート回転数・・・0～400rpm

メインモータ・・・ACサーボ 2kw

サーボコントローラ制御

加工ヘッド・・・1軸 エアバック加圧方式

シリンダー昇降機構

加工ヘッド径・・・φ210mm

加工ヘッド回転数・・・0～200rpm

ワーク取り付け方法・・・バキュームクランプ

制御方式・・・シーケンサ制御

操作パネル・・・液晶タッチパネル

その他・・・オシレーション機構

フェーシング機構 NC制御

ブラシ軸×1



GaN用ダイヤモンドポリッシング

NANO-450-FODAb

450-ODBAb

SPECIFICATION

- 装置寸法・・・W1280×D1140×H2176
プレートサイズ・・・φ450mm アルミナセラミクス製
プレート回転数・・・10～100rpm
メインモータ・・・ギヤードモータ 2.2kw
インバータ制御
加工ヘッド・・・2軸 エアバック加圧方式
シリンダー昇降機構
加工ヘッド径・・・φ150mm
加工ヘッド回転数・・・10～100rpm
ワーク取り付け方法・・・バキュームクランプ
制御方式・・・シーケンサ制御
操作パネル・・・液晶タッチパネル
その他・・・オシレーション機構
ブラシ軸×1
耐薬液腐蝕対応



GaAs Polishing Machine

NANO-450-ODBAb

NSP600-AT

SPECIFICATION

全自動研磨機

カセット カセット

ドライIN → ウェットOUT

装置寸法...W2230×D1530×H1870 (mm)

プレートサイズ...φ600mm SUS製

プレート回転数...1~125rpm

メインモータ... ACサーボ 3kw

サーボコントローラ制御

加工ヘッド...1軸 エアバック加圧方式

シリンダー昇降機構

加工ヘッド径...φ100~φ150mm

加工ヘッド回転数...1~250rpm

ワーク取り付け方法...バキュームクランプ

制御方式...シーケンサ制御

操作パネル...液晶タッチパネル

その他...オシレーション機構

エアバックブラシ軸×1

耐薬液腐蝕対応

ロボット仕様

FULLY AUTOMATIC POLISHER

GaAs. InP. Si. LT. LN. FINAL POLISHER

DRY IN

WET OUT

MAX φ3" - φ6"



NSP-600AT

NKP450-OAH

SPECIFICATION

装置寸法.....W1425×D1150×H2065 (mm)

プレートサイズ・φ450mm アルミナセラミクス製

砥石回転数.....0~2000rpm

メインモータ... サーボモータ 三相 200V 3kw

加工ヘッド..... 1軸 エアバック加圧方式

ボールねじサーボモーター昇降機構

加工ヘッド加圧・エアーバック加圧 MAX500Kg

加工ヘッド径...φ150mm

加工ヘッド回転数...0~1000rpm

ワーク取り付け方法...バキュームクランプ

制御方式...シーケンサ制御

操作パネル...液晶タッチパネル

その他...オシレーション機構

ケミカル対策...耐薬液腐蝕対応・エアーパージ

クリーン対応...HPフィルター循環システム



GaAs
CLEAN
POLISHER

NKP-450-OAH

GaAs CLEAN POLISHER
CHEMICAL & CORROSION PROOF

NANO-610DOC-2

SPECIFICATION

装置寸法・・・W1100×D1350×H2130

プレートサイズ・・・φ610mm アルミナセラミクス
製

プレート回転数・・・10～100rpm

メインモータ・・・ギヤードモータ 3.7kw
インバータ制御

加工ヘッド・・・2軸 シリンダー加圧方式
シリンダー昇降機構

加工ヘッド径・・・φ175mm

加工ヘッド回転数・・・1～100rpm

ワーク取り付け方法・・・メカクランプ

制御方式・・・シーケンサ制御

操作パネル・・・液晶タッチパネル

その他・・・オシレーション機構

耐薬液腐蝕対応



GaAsポリッシング機

NANO-610DOC-2

POLISHING MACHINE FOR GaAs
FOR φ3", φ4", φ6"
CHEMICAL & CORROSION PROOF

1400-Dab-1/1

SPECIFICATION

装置寸法・・・W2050×D1950×H2830 (mm)

プレートサイズ・・・φ1400mm SUS製

プレート回転数・・・10～100rpm

メインモータ・・・ギヤードモータ 15kw
インバータ制御

加工ヘッド・・・2軸 エアバック加圧方式
LMガイド・ボールネジ昇降機構

加工ヘッド径・・・φ475mm セラミクス製

加工ヘッド回転数・・・0～75rpm

ワーク取り付け方法・・・バキュームクランプ

ドレス軸・・・1軸 ブラシ・ダイヤモンドペレット対応
強制駆動

制御方式・・・シーケンサ制御

操作パネル・・・液晶タッチパネル

その他・・・耐薬液腐蝕対応

GaAsポリッシング機



NANOTECH-1400Dab-1/1

- φ6" POLISHING MACHINE FOR GaAs
- ・φ485 AIR BAG
- ・CHEMICAL PROOF
- ・RISE & SHOWER INSTALLED
- ・DRESSER (BRUSH, ELECTRODEPOSITION)
- ・COMPULSION DRIVE